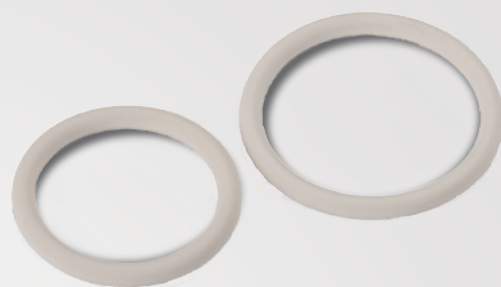


卓越物理機械密封穩定性

- 適合應用在NF3或O2-CF4電漿氣體的環境。對於產品清潔度、高溫密封性能穩定性、彈性體裂解特性(Crack)與重量損失率，均能表現出極優異且穩定之特性。
- 具有優異的物理特性，並採用專利之聚合技術，大幅提高裂解溫度性能(無氧環境TGA測試)。
- 連續操作溫度可達285°C
- 對於在鋁件接著應用上，搭配專利接著技術，可應用於閉合閘門密封件(Bonded Gate Seals, Slit Valve Seals)。亦能充分表現出本產品之優異性能。
- 產品之最後包裝與清潔均於無塵室內完成。



ea 特性與優點

最適合應用於化學氣相沉積製程
極低金屬離子析出物
高潔淨度、低汙染
適合應用於高溫乾式蝕刻製程
長時程、穩定並優異的高溫密封性能
廣泛的電漿耐受性
極佳的化學耐受性
優異的壓縮變形率
最高連續使用溫度285°C

ea 建議應用位置

反應槽密封件(Chamber, Lid Seals)
閉合閘門密封件(Bonded Gate Seals)
閥件密封件(Valve Seals)

ea 典型物理特性

硬度(Shore A)	82
顏色	米白色
模數(100 % Modulus)	3.8
拉伸強度(Tensile, MPa)	15.5
延伸率(Elongation, %)	230
壓縮變形率(%, 70 hr @ 250°C)	28
最高連續使用溫度(°C)	285

ea 建議應用製程

乾式蝕刻(Dry Etch)
擴散(Diffusion)
離子植入(Ion Implant)
快速回火(RTP)
化學氣相沉積(CVD, PECVD, HDPCVD, SACVD)
氧化製程(Oxidation)